

表1-1. 装置等の利用負担金表

(学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用、中小企業（備考5）のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用)

新利用料金【消費税込み】 : 2017年4月1日から適用

装置群	装置等			利用料金 (一時間当り)	設置場所
	No.	機器名	メーカー名		
A ナノリソグラフィ装置	A1	高速高精度電子ビーム描画装置	(株)エリオニクス	26,430円	イロールーム
	A2	露光装置 (ステッパー)	(株)ニコン	10,570円	イロールーム
	A3	レーザー直接描画装置	(株)日本レーザー(Heidelberg)	7,170円	イロールーム
	A4	高速マスクレス露光装置	(株)ナノシステムソリューションズ	4,080円	イロールーム
	A5	両面マスクアライナー	ズース・マイクロテック(株)	2,850円	イロールーム
	A6	紫外線露光装置	ミカサ(株)	440円	イロールーム
	A7	厚膜フォトレジスト用スピコーティング装置	ズース・マイクロテック(株)	1,560円	イロールーム
	A8	レジスト塗布装置	(株)カナメックス	790円	イロールーム
	A9	スプレーコータ	ウシオ電機(株)	1,010円	イロールーム
	A10	レジスト現像装置	(株)カナメックス	790円	イロールーム
	A11	ウエハスピン洗浄装置	(株)カナメックス	1,470円	イロールーム
	A12	ICP質量分析装置	アジレント・テクノロジー(株)	2,450円	イロールーム
	A13	超微細インクジェット描画装置	(株)SIJテクノロジー	1,080円	イロールーム
	A14	有機現像液型レジスト現像装置	(株)カナメックス	1,060円	イロールーム
	A15	大面積超高速電子線描画装置	(株)アドバンテスト	34,890円	加工・評価室1
A51	E B 露光装置	(株)東京テクノロジー	970円	桂クリーンルーム	
A52	ステッパ	(株)大日本科研	9,350円	桂クリーンルーム	
A53	移動マスク紫外線露光装置	(株)大日本科研	4,320円	桂クリーンルーム	
A54	両面マスクアライナー露光装置	ユニオン光学(株)	680円	桂クリーンルーム	
B ナノ材料加工・創製装置	B1	多元スパッタ装置 (仕様A)	キャンオネルバ(株)	4,040円	加工・評価室1
	B2	多元スパッタ装置 (仕様B)	キャンオネルバ(株)	3,850円	加工・評価室1
	B3	電子線蒸着装置	キャンオネルバ(株)	3,170円	クリーンルーム
	B4	真空蒸着装置	(株)サンバック	620円	加工・評価室1
	B5	プラズマCVD装置	住友精密工業(株)	6,420円	クリーンルーム1
	B6	集束イオンビーム走査電子顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)	12,950円	加工・評価室1
	B7	熱酸化炉	光洋サーモシステム(株)	940円	クリーンルーム2
	B8	深堀りドライエッチング装置	サムコ(株)	5,270円	クリーンルーム1
	B9	磁気中性線放電ドライエッチング装置	(株)アルバック	5,290円	クリーンルーム1
	B10	ドライエッチング装置	サムコ(株)	910円	クリーンルーム2
	B11	電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置	(株)エリオニクス	3,630円	クリーンルーム2
	B12	シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム	住友精密工業(株)	4,230円	クリーンルーム1
	B13	シリコン犠牲層ドライエッチングシステム	XACTIX	2,130円	クリーンルーム2
	B14	赤外フェムト秒レーザー加工装置	AVESTA PROJECT	3,550円	加工・評価室2
	B15	レーザーアニール装置	AOV(株)	3,370円	加工・評価室2
	B16	紫外線ナノインプリントボンドアライメント装置	ズース・マイクロテック(株)	4,520円	イロールーム
	B17	基板接合装置	ズース・マイクロテック(株)	4,110円	イロールーム
	B18	レーザーダイシング装置	(株)東京精密	6,780円	加工・評価室1
	B19	ダイシングソー	(株)DISCO	610円	加工・評価室1
	B20	真空マウンター	日本電気(株)	530円	加工・評価室1
	B21	紫外線照射装置	(株)テクノビジョン	230円	加工・評価室1
	B22	エキスパンド装置	(株)テクノビジョン	120円	加工・評価室1
	B23	ウェッジワイヤボンダ	ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)	260円	加工・評価室2
	B24	ボールワイヤボンダ	ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)	270円	加工・評価室2
	B25	ダイボンダ	ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)	240円	加工・評価室2
	B26	ナノインプリントシステム	Obducat Technologies AB社	1,080円	イロールーム
B27	赤外透過評価検査/非接触厚み測定機	(株)モリテックス	1,020円	イロールーム	
B51	パリレン成膜装置	SCS	360円	桂クリーンルーム	
B52	ICP-RIE装置	(株)アルバック	500円	桂クリーンルーム	
B53	簡易RIE装置	サムコ(株)	330円	桂クリーンルーム	
B54	ウエハ接合装置	ボンドテック(株)	4,560円	桂クリーンルーム	
B55	ナノインプリント装置	(株)マルニ	180円	桂クリーンルーム	
B56	ダイシング装置	(株)DISCO	570円	桂クリーンルーム	

C ナノ材料分析・評価装置	C1	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ	4,830円	加工・評価室1
	C2	分析走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ	6,720円	加工・評価室1
	C3	高速液中原子間力顕微鏡	(株)生体分子計測研究所	2,570円	加工・評価室2
	C4	走査型プローブ顕微鏡システム	JPKインストルメンツ	2,340円	加工・評価室2
	C5	共焦点レーザー走査型顕微鏡	オリンパス(株)	2,500円	加工・評価室2
	C6	3D測定レーザー顕微鏡	オリンパス(株)	1,000円	加工・評価室1
	C8	全反射励起蛍光イメージングシステム	オリンパス(株)	2,040円	加工・評価室2
	C9	長時間撮影蛍光イメージングシステム	オリンパス(株)	1,550円	加工・評価室2
	C10	X線回折装置	(株)リガク	2,720円	加工・評価室1
	C11	分光エリプソメーター	大塚電子(株)	1,660円	クリーンルーム2
	C12	光ピンセットシステム	JPKインストルメンツ	1,960円	加工・評価室2
	C13	ゼータ電位・粒径測定システム	大塚電子(株)	1,070円	加工・評価室2
	C14	ダイナミック光散乱光度計	大塚電子(株)	1,430円	加工・評価室2
	C15	触針式段差計1	BRUKER	460円	クリーンルーム2
	C15	触針式段差計2	BRUKER	460円	加工・評価室1
	C16	マイクロシステムアナライザ	ポリテックジャパン(株)	2,830円	加工・評価室1
	C17	(プローバ)	(株)日本マイクロニクス	630円	加工・評価室1
	C18	(真空プローバ)	カスケード・マイクロテック(株)	2,470円	加工・評価室1
	C19	パワーデバイスアナライザ+ (C17プローバ)	アジレント・テクノロジー(株)	800円	加工・評価室1
	C20	インピーダンスアナライザ+ (C18真空プローバ)	アジレント・テクノロジー(株)	330円	加工・評価室1
	C21	光ヘテロダイン微小振動測定装置	ネオアーク(株)	1,060円	加工・評価室2
	C22	超微小材料機械変形評価装置	(株)エリオニクス	1,060円	加工・評価室2
	C24	セルテストシステム	(株)東陽テクニカ(Solartron)	1,050円	加工・評価室2
	C25	卓上顕微鏡(SEM)	(株)日立ハイテクノロジーズ	390円	クリーンルーム1
	C26	高周波伝送特性測定装置 (C27+C28+C29)	(株)アポロウェーブ	350円	加工・評価室1
	C27	(RFプローブキット)	(株)アポロウェーブ	140円	加工・評価室1
	C28	(ネットワークアナライザ)	(株)アポロウェーブ	360円	加工・評価室1
	C29	(半導体パラメータアナライザ)	(株)アポロウェーブ(Keithley)	350円	加工・評価室1

備考

- 上記表中の利用料は、1時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、これに当該機器利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。
- 1時間未満の機器利用及び1時間を超える機器利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。
- 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。
- 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。
- 中小企業とは中小企業基本法第2条における中小企業者の範囲に含まれる者を言います。

業種分類	中小企業基本法の定義
製造業その他	資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業	資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業	資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業	資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

表1-2. 装置等の利用負担金表

(中小企業を除く企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用
及び ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利用)

新利用料金【消費税込み】 : 2017年4月1日から適用

装置群	装置等			利用料金 (一時間当り)	設置場所
	No.	機器名	メーカー名		
A ナノリソグラフィ装置	A1	高速高精度電子ビーム描画装置	(株)エリオニクス	42,290円	イエロールーム
	A2	露光装置 (ステッパー)	(株)ニコン	16,920円	イエロールーム
	A3	レーザー直接描画装置	(株)日本レーザー(Heiderberg)	11,480円	イエロールーム
	A4	高速マスクレス露光装置	(株)ナノシステムソリューションズ	6,530円	イエロールーム
	A5	両面マスクアライナー	ズース・マイクロテック(株)	4,560円	イエロールーム
	A6	紫外線露光装置	ミカサ(株)	710円	イエロールーム
	A7	厚膜フォトレジスト用スピコーティング装置	ズース・マイクロテック(株)	2,490円	イエロールーム
	A8	レジスト塗布装置	(株)カナメックス	1,270円	イエロールーム
	A9	スプレーコータ	ウシオ電機(株)	1,610円	イエロールーム
	A10	レジスト現像装置	(株)カナメックス	1,270円	イエロールーム
	A11	ウエハスピン洗浄装置	(株)カナメックス	2,360円	イエロールーム
	A12	ICP質量分析装置	アジレント・テクノロジー(株)	3,930円	イエロールーム
	A13	超微細インクジェット描画装置	(株)SIJテクノロジ	1,720円	イエロールーム
	A14	有機現像液型レジスト現像装置	(株)カナメックス	1,690円	イエロールーム
	A15	大面積超高速電子線描画装置	(株)アドバンテスト	55,830円	加工・評価室 1
	A51	E B 露光装置	(株)東京テクノロジー	1,550円	桂クリーンルーム
	A52	ステッパ	(株)大日本科研	14,960円	桂クリーンルーム
	A53	移動マスク紫外線露光装置	(株)大日本科研	6,910円	桂クリーンルーム
	A54	両面マスクアライナー露光装置	ユニオン光学(株)	1,080円	桂クリーンルーム
	B ナノ材料加工・創製装置	B1	多元スパッタ装置 (仕様A)	キャノンアネルバ(株)	6,470円
B2		多元スパッタ装置 (仕様B)	キャノンアネルバ(株)	6,160円	加工・評価室 1
B3		電子線蒸着装置	キャノンアネルバ(株)	5,080円	クリーンルーム
B4		真空蒸着装置	(株)サンバック	1,000円	加工・評価室 1
B5		プラズマCVD装置	住友精密工業(株)	10,270円	クリーンルーム 1
B6		集束イオンビーム走査電子顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)	20,710円	加工・評価室 1
B7		熱酸化炉	光洋サーモシステム(株)	1,500円	クリーンルーム 2
B8		深堀りドライエッチング装置	サムコ(株)	8,430円	クリーンルーム 1
B9		磁気中性線放電ドライエッチング装置	(株)アルバック	8,460円	クリーンルーム 1
B10		ドライエッチング装置	サムコ(株)	1,450円	クリーンルーム 2
B11		電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置	(株)エリオニクス	5,800円	クリーンルーム 2
B12		シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム	住友精密工業(株)	6,770円	クリーンルーム 1
B13		シリコン犠牲層ドライエッチングシステム	XACTIX	3,410円	クリーンルーム 2
B14		赤外フェムト秒レーザー加工装置	AVESTA PROJECT	5,680円	加工・評価室 2
B15		レーザーアニール装置	AOV(株)	5,390円	加工・評価室 2
B16		紫外線ナノインプリントボンドアライメント装置	ズース・マイクロテック(株)	7,240円	イエロールーム
B17		基板接合装置	ズース・マイクロテック(株)	6,580円	イエロールーム
B18		レーザーダイシング装置	(株)東京精密	10,850円	加工・評価室 1
B19		ダイシングソー	(株)DISCO	980円	加工・評価室 1
B20		真空マウンター	日本電気(株)	850円	加工・評価室 1
B21		紫外線照射装置	(株)テクノビジョン	370円	加工・評価室 1
B22		エキスパンド装置	(株)テクノビジョン	200円	加工・評価室 1
B23		ウェッジワイヤボンダ	ハイソル(株) (ウエスト・ボンダ社)	420円	加工・評価室 2
B24		ボールワイヤボンダ	ハイソル(株) (ウエスト・ボンダ社)	430円	加工・評価室 2
B25		ダイボンダ	ハイソル(株) (ウエスト・ボンダ社)	390円	加工・評価室 2
B26		ナノインプリントシステム	Obducat Technologies AB社	1,720円	イエロールーム
B27		赤外透過評価検査/非接触厚み測定機	(株)モリテックス	1,630円	イエロールーム
B51		パルレン成膜装置	SCS	570円	桂クリーンルーム
B52		ICP-RIE装置	(株)アルバック	810円	桂クリーンルーム
B53		簡易RIE装置	サムコ(株)	520円	桂クリーンルーム
B54		ウエハ接合装置	ボンダテック(株)	7,300円	桂クリーンルーム
B55		ナノインプリント装置	(株)マルニ	280円	桂クリーンルーム
B56		ダイシング装置	(株)DISCO	920円	桂クリーンルーム

C ナノ材料分析・評価装置	C1	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ	7,720円	加工・評価室 1
	C2	分析走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ	10,760円	加工・評価室 1
	C3	高速液中原子間力顕微鏡	(株)生体分子計測研究所	4,110円	加工・評価室 2
	C4	走査型プローブ顕微鏡システム	JPKインストルメンツ	3,740円	加工・評価室 2
	C5	共焦点レーザー走査型顕微鏡	オリンパス(株)	4,000円	加工・評価室 2
	C6	3D測定レーザー顕微鏡	オリンパス(株)	1,610円	加工・評価室 1
	C8	全反射励起蛍光イメージングシステム	オリンパス(株)	3,270円	加工・評価室 2
	C9	長時間撮影蛍光イメージングシステム	オリンパス(株)	2,480円	加工・評価室 2
	C10	X線回折装置	(株)リガク	4,350円	加工・評価室 1
	C11	分光エリプソメーター	大塚電子(株)	2,650円	クリーンルーム 2
	C12	光ピンセットシステム	JPKインストルメンツ	3,140円	加工・評価室 2
	C13	ゼータ電位・粒径測定システム	大塚電子(株)	1,720円	加工・評価室 2
	C14	ダイナミック光散乱光度計	大塚電子(株)	2,290円	加工・評価室 2
	C15	触針式段差計 1	BRUKER	740円	クリーンルーム 2
	C15	触針式段差計 2	BRUKER	740円	加工・評価室 1
	C16	マイクロシステムアナライザ	ポリテックジャパン(株)	4,530円	加工・評価室 1
	C17	(プローバ)	(株)日本マイクロニクス	1,010円	加工・評価室 1
	C18	(真空プローバ)	カスケード・マイクロテック(株)	3,950円	加工・評価室 1
	C19	パワーデバイスアナライザ+ (C17プローバ)	アジレント・テクノロジー(株)	1,280円	加工・評価室 1
	C20	インピーダンスアナライザ+ (C18真空プローバ)	アジレント・テクノロジー(株)	530円	加工・評価室 1
	C21	光ヘテロダイン微小振動測定装置	ネオアーク(株)	1,690円	加工・評価室 2
	C22	超微小材料機械変形評価装置	(株)エリオニクス	1,690円	加工・評価室 2
	C24	セルテストシステム	(株)東陽テクニカ(Solartron)	1,680円	加工・評価室 2
	C25	卓上顕微鏡(SEM)	(株)日立ハイテクノロジーズ	620円	クリーンルーム 1
	C26	高周波伝送特性測定装置 (C27+C28+C29)	(株)アポロウェーブ	560円	加工・評価室 1
	C27	(RFプローブキット)	(株)アポロウェーブ	230円	加工・評価室 1
	C28	(ネットワークアナライザ)	(株)アポロウェーブ	570円	加工・評価室 1
	C29	(半導体パラメータアナライザ)	(株)アポロウェーブ(Keithley)	560円	加工・評価室 1

備考

- 1 上記表中の利用料は、1時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、これに当該機器利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。
- 2 1時間未満の機器利用及び1時間を超える機器利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。
- 3 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。
- 4 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。

表1-3. 装置等の利用負担金表
(ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない企業の単独利用)

新利用料金【消費税込み】 : 2017年4月1日から適用

装置群	装置等			利用料金 (一時間当り)	設置場所
	No.	機器名	メーカー名		
A ナノリソグラフィ装置	A1	高速高精度電子ビーム描画装置	(株)エリオニクス	52,870円	イエロールーム
	A2	露光装置 (ステッパー)	(株)ニコン	21,150円	イエロールーム
	A3	レーザー直接描画装置	(株)日本レーザー(Heiderberg)	14,350円	イエロールーム
	A4	高速マスクレス露光装置	(株)ナノシステムソリューションズ	8,160円	イエロールーム
	A5	両面マスクアライナー	ズース・マイクロテック(株)	5,700円	イエロールーム
	A6	紫外線露光装置	ミカサ(株)	880円	イエロールーム
	A7	厚膜フォトレジスト用スピコーティング装置	ズース・マイクロテック(株)	3,110円	イエロールーム
	A8	レジスト塗布装置	(株)カナメックス	1,590円	イエロールーム
	A9	スプレーコータ	ウシオ電機(株)	2,010円	イエロールーム
	A10	レジスト現像装置	(株)カナメックス	1,590円	イエロールーム
	A11	ウエハスピン洗浄装置	(株)カナメックス	2,950円	イエロールーム
	A12	ICP質量分析装置	アジレント・テクノロジー(株)	4,910円	イエロールーム
	A13	超微細インクジェット描画装置	(株)SIJテクノジ	2,150円	イエロールーム
	A14	有機現像液型レジスト現像装置	(株)カナメックス	2,110円	イエロールーム
	A15	大面積超高速電子線描画装置	(株)アドバンテスト	69,780円	加工・評価室 1
	A51	E B 露光装置	(株)東京テクノロジー	1,930円	桂クリーンルーム
	A52	ステッパ	(株)大日本科研	18,700円	桂クリーンルーム
	A53	移動マスク紫外線露光装置	(株)大日本科研	8,630円	桂クリーンルーム
	A54	両面マスクアライナー露光装置	ユニオン光学(株)	1,350円	桂クリーンルーム
	B ナノ材料加工・創製装置	B1	多元スパッタ装置 (仕様 A)	キャンオネルバ(株)	8,080円
B2		多元スパッタ装置 (仕様 B)	キャンオネルバ(株)	7,700円	加工・評価室 1
B3		電子線蒸着装置	キャンオネルバ(株)	6,340円	クリーンルーム
B4		真空蒸着装置	(株)サンバック	1,250円	加工・評価室 1
B5		プラズマCVD装置	住友精密工業(株)	12,840円	クリーンルーム 1
B6		集束イオンビーム走査電子顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)	25,890円	加工・評価室 1
B7		熱酸化炉	光洋サーモシステム(株)	1,870円	クリーンルーム 2
B8		深堀りドライエッチング装置	サムコ(株)	10,540円	クリーンルーム 1
B9		磁気中性線放電ドライエッチング装置	(株)アルバック	10,570円	クリーンルーム 1
B10		ドライエッチング装置	サムコ(株)	1,810円	クリーンルーム 2
B11		電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置	(株)エリオニクス	7,250円	クリーンルーム 2
B12		シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム	住友精密工業(株)	8,470円	クリーンルーム 1
B13		シリコン犠牲層ドライエッチングシステム	XACTIX	4,270円	クリーンルーム 2
B14		赤外フェムト秒レーザー加工装置	AVESTA PROJECT	7,100円	加工・評価室 2
B15		レーザーアニール装置	AOV(株)	6,730円	加工・評価室 2
B16		紫外線ナノインプリントボンドアライメント装置	ズース・マイクロテック(株)	9,050円	イエロールーム
B17		基板接合装置	ズース・マイクロテック(株)	8,220円	イエロールーム
B18		レーザーダイシング装置	(株)東京精密	13,560円	加工・評価室 1
B19		ダイシングソー	(株)DISCO	1,230円	加工・評価室 1
B20		真空マウンター	日本電気(株)	1,060円	加工・評価室 1
B21		紫外線照射装置	(株)テクノビジョン	470円	加工・評価室 1
B22		エキスパンド装置	(株)テクノビジョン	250円	加工・評価室 1
B23		ウェッジワイヤボンダ	ハイソル(株) (ウエスト・ボンダ社)	530円	加工・評価室 2
B24		ボールワイヤボンダ	ハイソル(株) (ウエスト・ボンダ社)	540円	加工・評価室 2
B25		ダイボンダ	ハイソル(株) (ウエスト・ボンダ社)	490円	加工・評価室 2
B26		ナノインプリントシステム	Obducat Technologies AB社	2,150円	イエロールーム
B27		赤外透過評価検査/非接触厚み測定機	(株)モリテックス	2,030円	イエロールーム
B51		パルレン成膜装置	SCS	720円	桂クリーンルーム
B52		ICP-RIE装置	(株)アルバック	1,010円	桂クリーンルーム
B53		簡易RIE装置	サムコ(株)	650円	桂クリーンルーム
B54		ウエハ接合装置	ボンドテック(株)	9,120円	桂クリーンルーム
B55		ナノインプリント装置	(株)マルニ	350円	桂クリーンルーム
B56		ダイシング装置	(株)DISCO	1,150円	桂クリーンルーム

C ナノ材料分析・評価装置	C1	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ	9,650円	加工・評価室 1
	C2	分析走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ	13,440円	加工・評価室 1
	C3	高速液中原子間力顕微鏡	(株)生体分子計測研究所	5,140円	加工・評価室 2
	C4	走査型プローブ顕微鏡システム	JPKインストルメンツ	4,670円	加工・評価室 2
	C5	共焦点レーザー走査型顕微鏡	オリンパス(株)	5,000円	加工・評価室 2
	C6	3D測定レーザー顕微鏡	オリンパス(株)	2,010円	加工・評価室 1
	C8	全反射励起蛍光イメージングシステム	オリンパス(株)	4,090円	加工・評価室 2
	C9	長時間撮影蛍光イメージングシステム	オリンパス(株)	3,110円	加工・評価室 2
	C10	X線回折装置	(株)リガク	5,440円	加工・評価室 1
	C11	分光エリプソメーター	大塚電子(株)	3,310円	クリーンルーム 2
	C12	光ピンセットシステム	JPKインストルメンツ	3,920円	加工・評価室 2
	C13	ゼータ電位・粒径測定システム	大塚電子(株)	2,150円	加工・評価室 2
	C14	ダイナミック光散乱光度計	大塚電子(株)	2,860円	加工・評価室 2
	C15	触針式段差計 1	BRUKER	920円	クリーンルーム 2
	C15	触針式段差計 2	BRUKER	920円	加工・評価室 1
	C16	マイクロシステムアナライザ	ポリテックジャパン(株)	5,660円	加工・評価室 1
	C17	(プローバ)	(株)日本マイクロニクス	1,260円	加工・評価室 1
	C18	(真空プローバ)	カスケード・マイクロテック(株)	4,940円	加工・評価室 1
	C19	パワーデバイスアナライザ+ (C17プローバ)	アジレント・テクノロジー(株)	1,600円	加工・評価室 1
	C20	インピーダンスアナライザ+ (C18真空プローバ)	アジレント・テクノロジー(株)	660円	加工・評価室 1
	C21	光ヘテロダイン微小振動測定装置	ネオアーク(株)	2,110円	加工・評価室 2
	C22	超微小材料機械変形評価装置	(株)エリオニクス	2,110円	加工・評価室 2
	C24	セルテストシステム	(株)東陽テクニカ(Solartron)	2,100円	加工・評価室 2
	C25	卓上顕微鏡(SEM)	(株)日立ハイテクノロジーズ	780円	クリーンルーム 1
	C26	高周波伝送特性測定装置 (C27+C28+C29)	(株)アポロウェーブ	700円	加工・評価室 1
	C27	(RFプローブキット)	(株)アポロウェーブ	290円	加工・評価室 1
	C28	(ネットワークアナライザ)	(株)アポロウェーブ	710円	加工・評価室 1
	C29	(半導体パラメータアナライザ)	(株)アポロウェーブ(Keithley)	700円	加工・評価室 1

備考

- 1 上記表中の利用料は、1時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、これに当該機器利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。
- 2 1時間未満の機器利用及び1時間を超える機器利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。
- 3 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。
- 4 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。

表 2. 装置等の利用負担金の上限

利用者種別	利用料 (1テーマ当たり)
(1) 京都大学の教職員及び学生 (2) 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者	3 2 4 万円
上記以外の者	1, 4 0 4 万円

備考

- 上記表中の装置利用料は、1テーマ当たりの利用に係る上限額（消費税相当額を含む）です。
なお、1テーマの継続期間6ヶ月です。

表 3. 技術代行における技術料

1時間当たり
3,400円

備考

- 上記表中の料金は、1時間の技術代行にかかる金額（消費税相当額を含む。）であり、これに利用時間数を乗じた金額を技術料とします。
なお、上記の利用時間は、装置時間と事前検討に要する時間等を合計した時間とします。
- 1時間未満の技術代行及び1時間を超える技術代行に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の技術代行として、技術料を算出するものとします。
- なお、技術代行においても、上記の装置利用負担金及び表4の基本料金を負担いただきます。

表 4. 基本料金表

利用者種別	基本料金 (1人・1時間当たり)
(1) 京都大学の教職員及び学生 (2) 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者 でかつ、ナノプラットフォーム事業の利用者	5 0 0 円
(5) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者で かつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者 (6) ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業	8 0 0 円
(7) 企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者 (8) その他、上記 (1)～(7)に該当しない者	1, 0 0 0 円

備考

- 上記表中の利用料は、1時間当たりの実験室等利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、これに実験室等の利用時間数を乗じた金額を1人当たりの基本料金とします。
- 複数の者が実験室等を利用する場合については、上記1の1人当たりの基本料金に実験室等の利用人数を乗じた金額を基本料金とします。

表 5. サテライトラボ（専有部分）・セミナー室の利用料金

実験室等	利用料	
	1日当たり	1時間当たり
サテライトラボ (専有部分) セミナー室	1 6 5 円	2 1 円

備考

- 上記表中の料金は、実験室等の床面積1平方メートルあたりの1日又は1時間の利用にかかる金額（消費税相当額を含む）であり、これに当該実験室等の床面積及び利用日数又は利用時間数を乗じた金額とします。
- 1時間未満の実験室等利用及び1時間を超える実験室等利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の実験室等利用と
利用料金を算出するものとします。
- 複数の実験室等を利用する場合については、各実験室等の利用料を合算した金額を利用料金とします。

表 6. 装置等の利用中止に伴うキャンセル料

区 分	キャンセル料
利用開始日の8日前から30日前まで	利用負担金の額の50%
利用開始日当日から7日前まで	利用負担金の額の100%

備考

キャンセル料に円未満の端数が出た場合は、その端数を切り上げるものとします。

表7. 技術補助における技術料

※技術補助とは、利用者からの依頼、もしくはナノハブ職員からの提案に基づいて行う下記のような業務です。

- (1)ナノハブ職員が、利用時に立ち会って適宜行う装置操作等の補助
- (2)ナノハブ職員との利用開始後の技術相談（なお、利用開始前の技術相談は無料です。）
- (3)ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプロセス条件最適化検討
- (4)ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプログラミング

1 時間当たり	
	3,400円

備考

- 1 上記表中の料金は、1時間の技術補助にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、これに利用時間数を乗じた金額を技術料とします。
なお、上記の利用時間は、装置時間と事前検討に要する時間等を合計した時間とします。
- 2 1時間未満の技術補助及び1時間を超える技術補助に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の技術補助として、技術料を算出するものとします。
但し、短時間で対応可能な場合は除きます。

表8. 事前講習費（オペレ費）

※技術講習とは、利用者が初めて使用する装置について、事前に操作法などを修得していただく講習です。

利用者種別	事前講習費（1時間当たり）
(1) 京都大学の教職員及び学生 (2) 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者 かつ、ナノプラットフォーム事業の利用者 (4) ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業	1,700円
(5) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者 かつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者 (6) ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業	2,720円
(7) 企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者 (8) その他、上記（1）～（7）に該当しない者	3,400円

備考

- 1 上記表中の料金は、1時間の事前講習にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、これに利用時間数を乗じた金額を事前講習費とします。
- 2 1時間未満の事前講習及び1時間を超える事前講習に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の事前講習として、算出するものとします。
但し、短時間で対応可能な場合は除きます。
- 3 なお安全教育（初めてナノハブを利用される方に対して、施設・装置の利用に関する注意点を伝えるもの）については無料です。
- 4 上記事前講習費に加えて
 - ・表9に示す事前講習時の装置利用負担金
 - ・表4に示した基本料金
 - ・事前講習に要する消耗品費
 を合わせて負担していただきます。

表9. 事前講習費時の装置負担金

事前講習に用いる試料と利用者種別によって下表のように区分してします。

利用者種別	ナノハブ拠点の準備する標準試料を用いた事前講習時の装置利用負担金	ナノハブ拠点の準備する標準試料以外の試料を用いた事前講習時の装置利用負担金
(1) 京都大学の教職員及び学生 (2) 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者 かつ、ナノプラットフォーム事業の利用者 (4) ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業	表1-1に示した装置利用負担金の半額	表1-1に示した装置利用負担金
(5) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者 かつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者 (6) ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業	表1-2に示した装置利用負担金の半額	表1-2に示した装置利用負担金
(7) 企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者 (8) その他、上記（1）～（7）に該当しない者	表1-3に示した装置利用負担金の半額	表1-3に示した装置利用負担金